

Aka-Brief #8 钛合金



图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

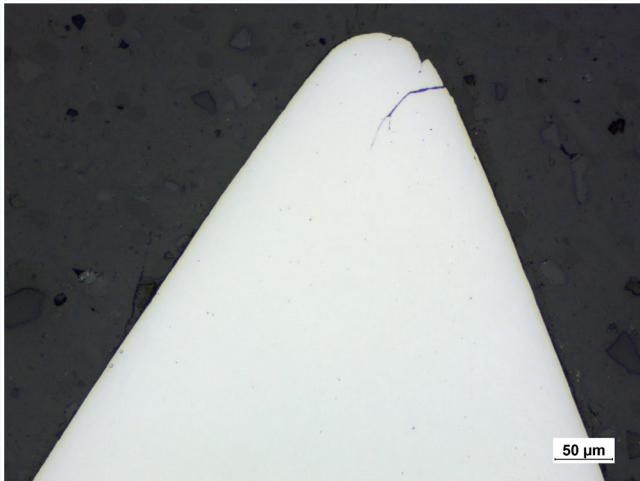
样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

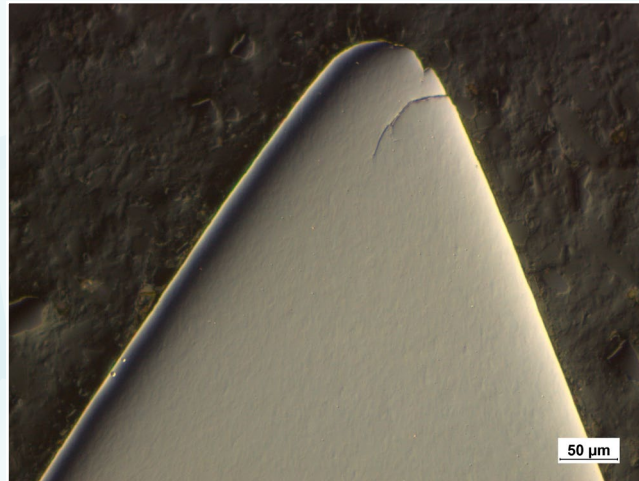
**96毫升 Fumed Silica,
2毫升 H₂O₂ (30%),
2毫升 NH₄OH (25%).

这种混合物应该在使用新鲜时（几个小时之内），并定期搅拌。

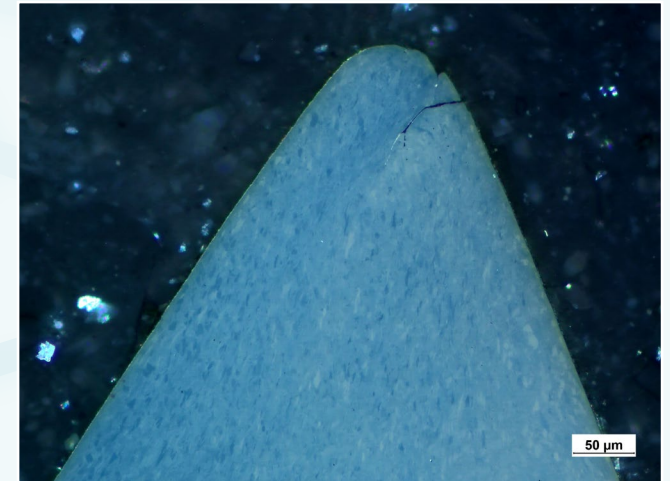
Aka-Brief #8 钛合金



TiAl4V %SS



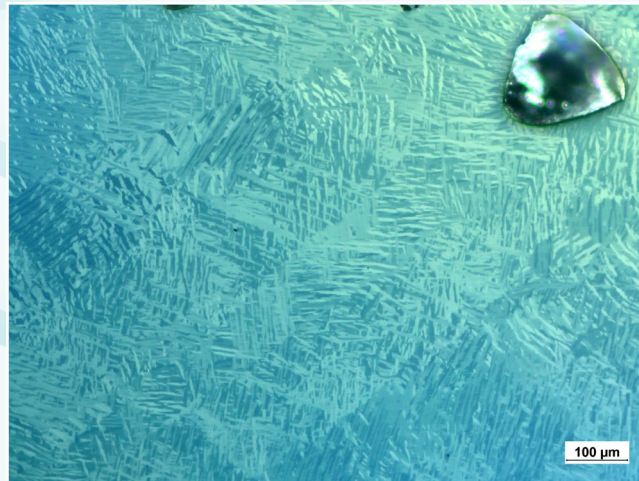
TiAl4V &SS



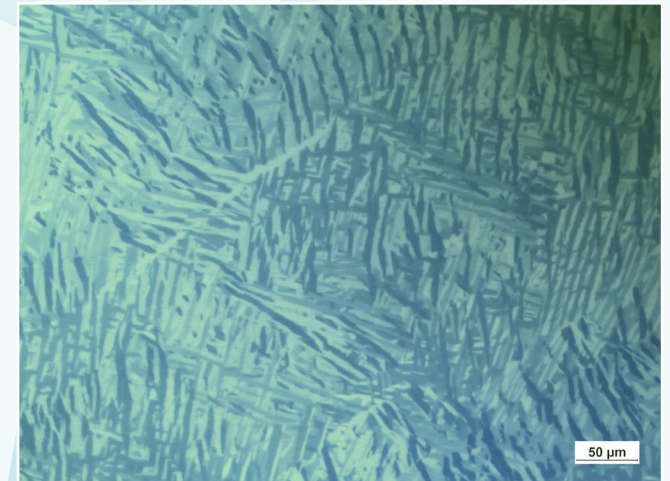
TiAl4V Ž@bVXU &SS



3DTiAl4V, 微分干涉衬度像, 100倍



3DTiAl4V, 偏正光+Lambda补偿片, 100倍



3DTiAl4V, 偏正光+Lambda补偿片, 200倍